化学物質制御パネルと先行温度コントローラ

極めて安定した温度制御

はじめに

現代では、半導体プロセスおよびPVプロセスでの反応成分の多くは液相でしか入手できません。それらの成分を技術に使用できるようにするため、適切な供給システムを採用しています。その方法の1つは、気体媒体を液体の中に流すことにより液体蒸気を吸収する手法に基づいています。

そのようなキャリアガスの流れはMFCで制御され、ディップチューブを通じて液体容器に導入されます。そして、キャリアと蒸気の混合物が、別の上部出口を通って容器から出ます。プロセス全体およびプロセス間で同じ吸収率を維持するには、液体媒体の温度を正確に制御する必要があります。この目的のために、乾燥槽環境用の強力な複合加熱/冷却エンジンを独自に開発しました。

特徴

本システムには、さまざまな供給業者が提供している一般的に広く使われている化学物質容器はすべて取り付けることができます。不定期に珍しいバージョンの容器を使用する場合でも、調節が可能です。上部断熱カバーは特別仕様として設計され、極めて安定した温度制御に大きく寄与します。さらに本システムは、現在の液体の水位および温度を視覚情報および電子情報の両方で提供します。

流体を安全かつクリーンな状態で扱うために、全プラスチック製のガス・蒸気ハンドリング供給パネルを、プロセス反応炉と媒体供給源との間のマニホールドインターフェイスとして特別に開発しました。このパネルは、容器内の圧力の監視と、過圧状態になった場合の自動ベントという重要な機能を担っています。

利便性を最大限にするため、ユースポイントの容器の充填は、経済的な大容量化学物質供給装置から行います。そのような大容量液体供給システムにより、小容量の容器をいくつも使用することなく、化学媒体を自動で安全に連続して使用することができます。

SVCS Process Innovation s.r.o.
Optátova 37, 637 00 Brno
CZECH REPUBLIC
e-mail: info@svcs.eu
http://www.svcs.eu

SVCS CO.
330 S Pineapple Ave. S-110
Sarasota, Florida 34236, USA
e-mail: info@svcspi.com
http://www.svcspi.com

Advanced Equipment MP Co. Ltd.
2-30-4 Jyosui Minami-cho Kodaira-shi
Tokyo, Japan 187-0021
e-mail: saitoh@aempjp.com
www.aempjp.com

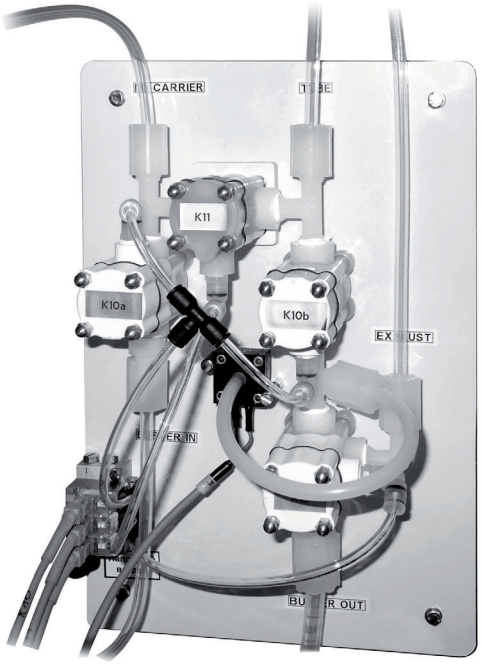
SVCS Process Innovation

化学物質制御パネルと先行温度コントローラ

技術データ

技術パラメータ

寸法（幅×高さ×奥行）	320 x 240 x 320 mm
液体容器の直径	145-155 mm
重量	15 kg
最大消費電力	150 W
雰囲気に対する最大加熱温度	+50 °C
雰囲気に対する最大冷却温度	-20 °C
温度制御安定性	+/-0.1 °C
冷却能力	30 W



欧州連合
欧州地域開発基金
あなたの未来への投資

© SVCS 01/2012